

An die Mitglieder
der VPP-Bezirksgruppe Mitte-Ost

Bezirksgruppe Mitte-Ost

Bezirksgruppensprecher

Dr. Jork Meyer
Dipl.-Biol., Patentanwalt

Carl Zeiss AG
Patentabteilung
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena

Telefon: d 03641 64-24000
E-Mail: jork.meyer@zeiss.com

16. Januar 2025

Einladung der Bezirksgruppe Mitte-Ost

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich lade Sie zu einer Veranstaltung ein, welche die VPP-Bezirksgruppe Mitte-Ost gemeinsam mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität, der Dienststelle Jena des DPMA und der Bezirksgruppe Mitte-Ost der GRUR im Rahmen der Jenaer Vorträge zum Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht durchführt.

Termin: Donnerstag, 30. Januar 2025 um 18.00 Uhr

Thema: Wie bessere Auflösung die Größe und Komplexität in der Herstellung von Lithografie-Optiken treibt – Technik und patentrechtlicher Schutz

Referent: Dr. Christoph Zaczek

Ort: Friedrich-Schiller-Universität Jena
1. Obergeschoss, HS6
Carl-Zeiss-Str. 3
07743 Jena

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer. Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jork Meyer

Veranstaltet durch:

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Gerd Bucerus-Lehrstuhl für Bürgerliches Recht
mit deutschem und internationalem gewerblichen
Rechtsschutz
Prof. Dr. Volker Michael Jänich
Carl-Zeiß-Straße 3
07743 Jena

Telefon: +49 (0) 3641 9-42110
E-Mail: volker.jaenich@uni-jena.de

Deutsches Patent- und Markenamt
Dienststelle Jena
LRD Markus Ortlieb
Goethestraße 1
07743 Jena

Telefon: +49 (0) 3641 40-5501
E-Mail: markus.ortlieb@dpma.de

Unterstützt durch:

Bezirksgruppe Mitte-Ost des



und

Bezirksgruppe Mitte-Ost der



Fotos: Jan-Peter Kasper/FSU, DPMA



FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA



Deutsches
Patent- und Markenamt

**JENAER VORTRÄGE
ZUM GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
UND URHEBERRECHT**

**Wie bessere Auflösung die Größe
und Komplexität in der Herstellung
von Lithografie-Optiken treibt –
Technik und patentrechtlicher
Schutz**

Dr. Christoph Zaczek

Donnerstag, 30. Januar 2025

18:00 Uhr s.t.

Friedrich-Schiller-Universität Jena,
1. Obergeschoss, HS 6,
Carl-Zeiß-Straße 3,
07743 Jena



WIE BESSERE AUFLÖSUNG DIE GRÖÖE UND KOMPLEXITÄT IN DER HERSTELLUNG VON LITHOGRAFIE-OPTIKEN TREIBT – TECHNIK UND PATENTRECHTLICHER SCHUTZ

Dr. Christoph Zaczek

Head of Architecture Process Development
Optics, Carl Zeiss

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde der weltweit erste EUV-Scanner für die Lithografie mit hoher numerischer Apertur (NA) an einen Halbleiterhersteller ausgeliefert, der eine Auflösung von 8 nm in der Chip-Produktion ermöglicht. Die Optik, die eine solche Auflösung ermöglicht, besteht aus asphärischen Spiegeln mit einer Größe von bis zu einem Meter und wird in Serie mit einer Präzision von weniger als 100 Picometern hergestellt.

In diesem Vortrag werden die Anforderungen, Herausforderungen und die Leistungsfähigkeit von Optikprozessen für Lithografie-Optiken von DUV bis EUV umfassend diskutiert. Auch auf den patentrechtlichen Schutz der Innovation wird eingegangen.

Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Verein "TechnikGeschichte in Jena e.V."

Christoph Zaczek ist Head of Architecture Process Development Optics bei Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing und seit 2019 ZEISS Fellow.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Optikprozess-Technologie bei ZEISS entwirft und entwickelt er und sein Team Prozessarchitekturen für langlebige, hochpräzise Lithografie-Optiken und deckt dabei alle Aspekte von der Konturierung bis zur Beschichtung ab.

Er erhielt seinen Masterabschluss in Physik von der Portland State University im Jahr 1995, sein Diplom von der Universität Stuttgart im Jahr 1998 und seine Promotion von der Universität Ulm im Jahr 2005.